

エレクトロニクス部会ニュース

Vol. 4, No. 4 (通巻 No. 20)

平成 23 年 9 月 28 日(水)

部会ニュース Vol. 4, No. 4 (通巻 No. 20) をお届けします。内容は**次回幹事会**のご案内、**平成 23 年度第 4 回幹事会**の議事概要です。

第 4 回幹事会の主な議事内容は、**平成 23 年度シンポジウム報告、化学工学会秋季大会シンポジウム報告、第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会、国際シンポジウム、部会の活性化等**についてです。

(1) 平成 23 年度第 5 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。

1. 日時：平成 23 年 12 月 7 日(水) 14:00~17:30
2. 場所：住友ベークライト(株)会議室
3. 議題：第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会(11 月 2 日開催)報告
来年度予算
来年度シンポジウム 等

(2) 平成 23 年度第 4 回幹事会

標記会議を 9 月 20 日(火)、住友ベークライト(株)にて開催しました。主な議事内容は次の通りです。

1. 平成 23 年度シンポジウム「エレクトロニクスにおける超先端材料とプロセス」

9 月 5 日(月)京都大学桂キャンパスにおいて開催されました。講演題目と講演者は次の通りです。参加者数は 50 名でした。

先端材料・技術革新による成長戦略	大林元太郎 (東レ)
メタマテリアル	田中拓男 (理化学研究所)
非線形効果による新規メモリー	平尾一之 (京都大学)
カーボンナノチューブ応用に向けた成長技術および実装・放熱応用	岩井大介 (富士通)
熱電素子最前線	山本 淳 (産業総合研究所)

2. 化学工学会秋季大会シンポジウム「エレクトロニクス材料とプロセス」

9 月 14 日名古屋工業大学において開催されました。招待講演は 2 件で、題目と講演者は次の通りです。一般講演は 16 件でした。参加者数は平均して約 30 名でしたが、川本浩二氏の講演は満席でした。

集積化 RF-MEMS が広げる新しいワイヤレス通信技術とユビキタス社会	鈴木健一郎(立命館大理工)
トヨタ自動車における将来電池の取り組み	川本浩二(トヨタ自電池研究所)

3. 第 3 回マイクロプロセッシング研究討論会

招待講演として Seoul National University の Seyong Oh 教授(元三星電子副社長)にお話しいただくことになりました。終了時刻を変更しないようにするため、石井正人

氏の御講演を来年度の本研究討論会に延期していただくことにしました。
11月2日(水)住友ベークライトで開催予定です。(3)行事予定を御覧下さい。会員の皆様の御参加をお願い致します。

4. 国際シンポジウム

2013年8月18日(日)ー23日(金)韓国において同時開催予定の9th World Congress of Chemical Engineering(WCCE9)および15th APCChE Congressにおいて当部会関連のシンポジウムを開催できないかを化学工学会に打診することになりました。

5. 部会の活性化

前回に引き続いて議論され、いろいろな意見が出ましたが、まずは電池関連の研究分野を当部会の活動分野とする努力をしたらどうかという意見が多くありました。

(3) 行事予定

1. 第3回マイクロプロセッシング研究討論会

日時 平成23年11月2日(水) 13:00-19:00

場所 住友ベークライト株式会社 20階特別第3会議室

〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目5-8 (天王洲パークサイドビル)

Phone: 03-5462-4257

地図は <http://www.sumibe.co.jp/company/offices/index.html> を御覧下さい。

招待講演

13:00ー13:45

Technology Convergence in Semiconductor Materials Engineering

Seyong Oh(Seoul National University)

講演

13:45ー14:15

21世紀に挑む「情報コミュニケーショントッパン」ー液晶ディスプレイ用カラーフィルター(LCD-CF)ー 渡辺 二郎(凸版印刷)

14:15ー14:45

半導体コート用ポジ型感光性PBO樹脂の開発

番場 敏夫(住友ベークライト)

14:45ー15:15

三井化学の回路実装材料

田原 修二(三井化学)

15:15ー15:45

スパッタイオンプレーティング法によるCuシード膜の作成

丸中 正雄(新明和工業)

15:45ー16:15

高度プリント配線板のプロセスの構築

高木 清(高木技術士事務所)

16:15ー16:45

Si結晶薄膜作製プロセスの化学工学

羽深 等(横浜国大)

16:45ー17:15

エレクトロニクスにおけるめっき技術

近藤 和夫(大阪府大)

17:20ー19:30 交流会

2. 半導体デバイスにおける MEMS と TSV 技術

主催：日本真空協会関西支部

日 時：2011 年 12 月 16 日（金曜日） 13:00 ～ 17:00

場 所：株式会社島津製作所関西支社マルチホール（大阪・阪急ターミナルビル 14 階）

参加費：日本真空協会会員、学生 1,000 円、協賛学会員 2,000 円、その他 3,000 円

定 員：60 名程度

講演プログラム

13:00～13:10 開催の挨拶

13:10～14:10 基調講演「MEMS 技術の最新動向-グリーン化への試みを含め-」

立命館大学 杉山 進

14:10～14:55 「3D デバイス技術の現状と展望」

グローバルネット株式会社 武野泰彦

14:55～15:10 休憩

15:10～15:55 「TSV におけるめっき技術」

清川メッキ株式会社 清川 肇

15:55～16:40 「MEMS 製造技術の半導体への展開」

住友精密工業株式会社 金尾寛人

16:40～16:50 閉会の挨拶

申し込み締切り：平成 23 年 12 月 9 日

<http://www.vacuum-jp.org/KANSAI/jituyou20111216.html>

申し込み方法

ご参加いただける場合は、以下のオンライン申込みページでお申し込みください。

[ONLINE申し込みページをクリック申し込み受付中](http://www.vacuum-jp.org/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=vac-jitu)

<http://www.vacuum-jp.org/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=vac-jitu>

問い合わせ先

日本真空協会関西支部 実用技術セミナー担当 丸中 正雄

電 話 (0798)56-5031 E-mail: marunaka.m@sa.shinmaywa.co.jp

会場の案内：株式会社島津製作所 関西支社 マルチホール

〒530-0012 大阪市北区芝田 1 丁目 1-4 阪急ターミナルビル 14 階

TEL (06)6373-6522 FAX (06)6373-6524

<http://www.shimadzu.co.jp/aboutus/company/access/kansai.html>

3. 化学工学会第 77 年会

日時：平成 24 年 3 月 15 日（木）-17 日（土）

場所：工学院大学新宿校舎